BL-19A/2023G170

STXM による高分子鎖の局所配向分布と力学物性の相関解明 Elucidation of the correlation between local orientation distribution and mechanical properties of polymer chains by STXM

荒川勝利^{1,*},竹中幹人²

¹京都大学大学院工学研究科,〒615-8246 京都府京都市西京区京都大学桂 ²京都大学化学研究所,〒1611-0011 京都府宇治市五ケ庄

Masato ARAKAWA^{1,*} and Mikihito TAKENAKA²

¹Graduate School of Engineering, Kyoto University, Kyoto daigaku-katsura, Nishikyo-ku, Kyoto 615-8530, Japan

² Institute for Chemical Research, Kyoto University, Gokasho, Uji, Kyoto 611-0011, Japan

3 結果および考察

1 <u>はじめに</u>

ポリエチレン(PE)はそ の優れた力学物性およ び成形性により、工業 的に広く使われる高分 子材料の1つである。以 前の研究[1, 2]におい て、X線散乱法によ り、延伸過程において 応力-ひずみ(S-S)曲線に



2 つの降伏点(図 1)を持 図 1. LLDPE の S-S 曲線 つ線状低密度ポリエチレン(LLDPE)では、第一降伏 点から第二降伏点に掛けてサブミクロンスケールの 密度揺らぎが誘起され、更に結晶相のフラグメンテ ーションやメカニカルメルトが起きることが明らか にされている。そこで、本研究では、延伸比が異な る LLDPE に対して、走査型透過 X 線顕微鏡(STXM) 測定を行い、延伸に伴う密度揺らぎの誘起、および 結晶、非晶部分における高分子鎖の配向を調べた。 これを調べることで、延伸下での結晶性高分子の力 学挙動における高分子鎖の配向の役割が明確になる と考えられる。

2 <u>実験</u>

実験に用いた LLDPE のポリスチレン換算の重量 平均分子量 Mw、分子量分布 Mw/Mn はそれぞれ、 2.1×10⁵、5.33 である。プレス機を用いて、溶融状 態(180 °C)で10分間加圧した後、25 °Cに急冷し 2 mm 厚のシートを作製した。このシートの LLDPE の密 度は 0.937 g/cm³ (20 °C)、重量分率結晶化度 w。は 0.49 であった。 L_0 , L はそれぞれ延伸前,延伸後のサン プルの長さとしたとき、延伸比 ε は次式で表される。 $\varepsilon = L/L_0$ … (1)

上記シートから砂時計型の試験片を打ち抜き、延伸 機を用い、 $\varepsilon = 1.11$ 、第二降伏点である $\varepsilon = 1.17$ まで 延伸速度 1 mm/min で延伸した。その後、 $\varepsilon = 1.0$ の試 験片と延伸した試験片の中心部分をクライオミクロ トーム(EM UC7、Leica Microsystems)により、厚さ 100 nm 程度に切り出し、超薄切片を作製した。この 切片に対して、PF BL-19A で STXM 測定を実施した。 入射 X線エネルギーは炭素の K 殻吸収端近傍である 280-320 eV の範囲で、同視野で、偏光(電場)方向が 延伸方向に対して平行および垂直方向それぞれとな るようにした。



図 2 に入射 X 線エネルギー318±2 eV における STXM 測定により観測された Optical Density (OD)像 の延伸比 ε 依存性を示す。OD は次式であり、

 $OD = -\ln (I / I_0) = \mu \rho t$ (2) *I* は X 線透過光強度、 I_0 は X 線入射光強度、 μ は 質量吸収係数、 ρ は密度、t は試料厚みである。ここ で,吸収端より離れた 320 eV 付近においては、OD は炭素の数密度のみに依存する[3]。それぞれの延伸 比において試料厚みは一定であるので、吸収端から 十分離れた 318±2 eV の OD 像(図 2)は密度を反映し ていると考えられる。図 3 は図 2 の OD 分布のヒス トグラムである。OD 分布では、延伸比が増加する と密度差が大きくなり、延伸誘起密度揺らぎを反映 した OD 像が得られたことが分かった。





また、結晶や高分子鎖の配向を評価するため、配 向秩序度(P_2)による空間不均一性の可視化を試みた [4]。OD は着目する化学結合と偏光 X線(電場)の向 きが平行のとき最大値を与え、垂直のとき最小値を 与える。例として、図 4 に ε = 1.11 における X線吸 収スペクトル(XAFS)を挙げる。290-295 eV のピーク は C-1s→ σ *C-C に由来する。延伸方向に対して平 行、垂直に偏光した X線による XAFS それぞれをピ ーク分離し、得られた C-1s→ σ *C-C の OD をそれ ぞれ OD₁、OD₁とすると

(3)

 $\langle P_2 \rangle = (OD_{\parallel} - OD_{\perp}) / (OD_{\parallel} + 2OD_{\perp})$

により定義される配向秩序度(P2)により、結晶や分 子鎖の配向像が得られる。(P2)>0の場合、結晶や 分子鎖は延伸方向に対して平行方向の配向が支配的 であり、 $(P_2) < 0$ の時、垂直の配向が支配的であ り、(P2) ≒ 0 の時、ランダム配向が支配的に存在す ることを示している。図 5(a-c)に ε = 1.0, 1.11, 1.17 そ れぞれの、図2と同視野における(P2)像を示し、図 5(d-f)に各延伸比それぞれの視野全体、OD 値上位 15%(高密度領域)、下位 15%(低密度領域)における領 域の(P2)分布のヒストグラムを示している。各領域 における(P2)分布から次のことが分かった。未延伸 である ε=1.0 では視野全体でランダム配向が主だ が、第一降伏点以降の ε = 1.11 では密度と分子鎖の 配向に相関関係が見られ、低密度領域では延伸方向 に対して平行方向となる配向が、高密度領域ではラ ンダム配向が支配的となることが分かった。そし

て、第二降伏点である ε = 1.17 では密度に関わら

ず、延伸方向に、より配向することが分かった。 STXM で観察された低、高密度領域は、それぞれ LLDPE のフィブリル間の低結晶性領域とフィブリル の高結晶性領域に対応すると考えられるので、延伸 過程における変形は次のように推察される。未延伸 時、高分子鎖と結晶の c 軸は視野全体でランダム配 が支配的である。しかし、第一降伏点以降の ε =1.11 では、低結晶化度領域では高結晶化度領域に比べて より延伸される不均一変形に発展する。メカニカル メルト、フラグメンテーションは変形が大きい低結 晶化度領域で主に発生し、この領域で密度が減少す る。一方、高結晶化度領域では延伸に関わらず結晶 が保持されるため、結晶の c 軸は延伸方向への配向 が弱まる。延伸下での各領域の結晶の変化の違いに より、サブミクロンスケールでの延伸誘起密度揺ら ぎと高分子鎖配向の空間的不均一性が発現する。ε= 1.11 以降、高結晶化度領域で保持されていた結晶は メカニカルメルト、フラグメンテーションを起こし 密度揺らぎは増大する一方、第二降伏点のε=1.17に おいて、高結晶化度領域の結晶の c 軸は、低結晶化 度領域の高分子鎖と同様に延伸方向に配向する。こ れは、絡み合いを伴う低結晶化度領域の高分子鎖よ り、フラグメンテーションを起こした結晶の方が容 易に回転し配向するためと考えられる。

4 <u>まとめ</u>

本研究では、異なる延伸比の LLDPE に対して STXM 測定を実施し、サブミクロンスケールにおけ る密度と高分子鎖配向の空間分布を評価した。 ε = 1.11 では、実空間における密度と配向の空間不均一 性を可視化した。また、LLDPE において、第一降伏 点から第二降伏点にかけて、サブミクロンスケール における結晶化度の異なる領域ごとに、段階的な結 晶の変化、材料の変形が発生することが分かった。

謝辞

測定に際し高エネルギー加速器研究機構(PF BL19A 担当)山下翔平助教に多大なご協力をいただ きました。ここに感謝致します。

参考文献

- [1] M. Takenaka, et al., Phys. Rev. E 75, 061802 (2007)
- [2] M. Kishimoto, et al., Macromolecules 53, 9097-9107 (2020)
- [3] Y. Wang, et al., Macromolecules 43, 8153-8161 (2010)
- [4] H. Cruz D, et al., Biomacromolecules 7, 3, 836–843 (2006)

<u>成果</u>

- 1. 公益社団法人高分子学会第71回高分子学会年 次大会優秀ポスター賞
- KIPS 京都高分子科学研究所 2024KIPS 若手高分 子シンポジウム ポスター賞

* arakawa.masato.44z@st.kyoto-u.ac.jp